## 第51巻第3号(通巻281号) 分離技術

<巻頭言>関西地区代表への就任挨拶	(大阪府立大学)	武藤	明徳141
<特集>水を使わない染色法〜超臨界染色について			
超臨界染色の現状と今後			
	(福井大学)	堀	照夫142
超臨界染色ならびにマイクロ・ナノカプセル			
	(福岡大学)	三島	健司150
超臨界流体染色の特徴および、その歴史と現況			
	(福井大学)	廣垣	和正157
超臨界二酸化炭素を利用した各種合成樹脂ボタンの染色プロセス			
	(金沢大学)	田村	和弘
	(大連工業大学)		鉄鎔 ·····164 俊
<若い"め">			
分離操作のスラリー評価への応用ーセラミックス温	は式成形プロセス	くにお	ける
成形体密度予測-			
	(法政大学)	岩田	尚也171
<連載>分離技術分野の有名な論文/書籍の紹介・飼	<b>解説</b>		
Ruth のケークろ過理論			
	(三進製作所)	岩田	政司178
国内で稼働している蒸留設備の現状調査結果(4)			
- 特殊蒸留とハイブリッド化-			
	(日本大学)	鈴木	功185
令和2年度卒業論文・修士論文および博士論文テー	<b>-</b> マ		190
会の動き			204

編集委員 委員長:高羽洋充(工学院大学)/副委員長:宇野繁理(東洋合成工業)/委 員:宮川雅矢(工学院大学) /大柴雄平(東京工業大学)/工藤翔慈(群馬工業高等専門学校)/坂部淳一(中央大学)/庄司 良(東京工業 高等専門学校)/平岡一高(日揮ホールディングス)/原 伸生(産業技術総合研究所)/松田弘幸(日本大学) /森 隆昌(法政大学)/三澤司朗(化学工業社)/中村秀美(奈良工業高等専門学校)/南雲 亮(名古屋工業 大学)